

2024年5月20日

開催案内 ワークショップ NGL2024

応用物理学会次世代リソグラフィ（NGL）技術研究会では、今年も NGL ワークショップ（ワークショップ NGL2024）を開催する予定です。本年も多くの方々に参加していただきたく、下記に概要をお知らせいたします。4 件の基調講演をはじめ、充実したプログラムを準備いたしました。皆様のご参加をお待ちしております。

応用物理学会 次世代リソグラフィ技術研究会
幹事長 宮本 恭幸

記

会期：2024年7月4日（木）、5日（金）

会場：東工大蔵前会館*（東急目黒線、大井町線大岡山駅前）

*詳細については蔵前会館のホームページ（下記 URL）をご覧ください。

<http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/access/index.html>

プログラム概要：

基調講演：

“EUV lithography - Overview and Outlook”

Anthony Yen 氏（ASML）

“我が国の半導体政策について”

齋藤尚史氏（経済産業省）

“熊本大学における半導体分野の人材育成・研究開発への取り組み”

青柳昌宏氏（熊本大学）

“次世代 DRAM 向けパターニング戦略”

岩城友博氏（マイクロンメモリジャパン）

技術セッション：

7/4 光リソグラフィ&アドバンストパターニング、レジスト材料、ポスターセッション

7/5 ナノインプリント、EB・計測・マスク技術、EUVL

*ポスターセッションでは軽食を提供いたします。

主催： 応用物理学会 次世代リソグラフィ技術研究会（分科会）

協賛： 応用物理学会 シリコンテクノロジー分科会

NGL2024 企画運営委員会：

委員長：宮本 恭幸 副委員長：岡崎 信次

委員：備前 大輔、古澤 孝弘、井谷 俊郎、中川 勝、石原 直、松井 真二、堀内 敏行、

田川 精一、三田 吉郎、雨宮 智宏、落合 幸徳、老泉 博昭、笑喜 勉、酒井 啓太、
小林 幸子、尹 成圓、鈴木 章義、引地 龍吾、伊藤 高臣、藤井 清、岩城 友博、
古巻 貴光、本多 孝義、渡邊 陽司、原田 哲男

事務局：相良好美

TEL：090-5403-1147

E-mail：ngl@jsap.or.jp

参加費※：税込み（消費税課税）表示

主催・協賛団体会員、学生：	3,000円（6月16日以前の申し込み） 4,000円（6月17日以降の申し込み）
一般：	18,000円（6月16日以前の申し込み） 20,000円（6月17日以降の申し込み）

※申し込み後、7月1日までに銀行振り込み等でお支払いください。

申し込み方法： 下記の申し込み専用ホームページからお申し込みください。

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=2826022165321700&EventCode=1898778286

応用物理学会次世代リソグラフィ技術研究会は、本ワークショップの他、年に3回程度、会員が無料で参加できる定例研究会を開催しております。当研究会には、法人（賛助）会員、個人会員としての入会が可能です。ご興味のある方は上記事務局までご連絡ください。

以上

東京工業大学 東工大蔵前会館 案内図

